

KLA 发布全新缺陷检测与检视产品组合

提高 KLA 在图案化晶圆缺陷检测、检视和分类中的优势

美国东部时间 2019 年 7 月 8 日 4:15 PM

加利福尼亚州米尔皮塔斯，2019 年 7 月 8 日/美通社/ - [KLA 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）今日发布 392x 和 295x 光学缺陷检测系统和 eDR7380™ 电子束缺陷检视系统。这些全新的检测系统是我们公司旗舰产品系列-图案晶圆平台的进一步拓展，其检测速度和灵敏度均有提升，代表了光学检测的新水准。全新电子束检视系统的创新使其自身价值进一步稳固，并成为缺陷和发现其产生根源之间的必要一环。对于领先的 3D NAND、DRAM 和逻辑集成电路（IC），该产品组合将缩短整个产品周期，加快其上市时间。

“为了有利润地制造下一代内存和逻辑芯片，对所需的制程控制要求之高也是前所未有的，” KLA 国际产品部执行副总裁 Ahmad Khan 说。“元件结构变得更小、更窄、更高、更深，并且形状更为复杂以及材料更为新颖。将缺陷与其他无害的物理变化分开 - 也就是从噪声中分离出所需信号-已成为一个非常棘手的难题。我很高兴地宣布我们的光学和电子束工程团队开发了一系列创新的系统，将缺陷的检测和检视相结合，这将推动我们的行业继续向前发展。”

392x 和 295x 光学图案晶圆缺陷检测系统在宽光谱等离子照射技术，传感器架构和整合芯片设计数据等方面都取得实质性的进步，其灵敏度、产量和良率相关的缺陷分类等功能都是业界翘楚。因此，与领先业界的前一代产品相比，新系统可以更为迅速地发现缺陷并提升良率，同时提供更为全面的在线监控。对于包括 EUV 光刻质量控制在内的各种检测应用，392x 和 295x 系统可以提供不同的波长范围并涵盖从浅沟槽隔离到金属化的所有制程层。

凭借一流的图像质量和通过一次测试获得完整缺陷分布图的独特能力，eDR7380 电子束晶圆缺陷检视系统可以在产品开发中更加迅速地捕获缺陷源，同时在生产制造中更快地检测偏移并且获取更为准确及可操作的数据。该系统能够对脆弱的 EUV 光刻工艺层进行检视。与 KLA 检测仪的独特结合可以缩短获取结果的时间，促进多种的 KLA 特定应用的使用，并通过智能采样和高效缺陷数据交换提升检测的灵敏度。

392x、295x 和 eDR7380 系统都可用作新系统或者对上一代的 39xx、29xx 或 eDR7xxx 系统进行升级。这些系统均具有未来的可扩展性，从而保护晶圆厂的资本投资。

所有新系统都已在全球领先的 IC 制造厂中安装运行，与其他机台一起共同用于制造创新的电子元件。为了确保芯片制造商所需的高性能和高生产效率，[KLA 全球综合服务网络](#)将对 392x、295x 和 eDR7380 系统提供支持。有关新缺陷检测和检视系统的更多信息，请参[阅产品组合信息页面](#)。

eDR®是 KLA 公司的注册商标。

关于 KLA-Tencor 公司：

KLA-Tencor 公司（又称“KLA Corporation”或“KLA”）致力于开发领先业界的设备与服务，以及整个电子行业的创新。我们为晶圆和光罩制造、集成电路、封装、印刷电路板和平板显示提供先进的工艺控制和工艺支持解决方案。与全球领先的客户密切合作，我们的物理学家、工程师、数据工程师和问题解决专员组成专家团队，共同设计推动世界前进的解决方案。更多相关信息，请访问公司网站 <https://www.kla.com/>（KLAC-P）。

前瞻性声明：

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 295x、392x 和 eDR7380 系统的预期性能以及缺陷减少为晶圆、设备、材料和芯片制造设施所带来的经济影响都是前瞻性陈述，并且符合“1995 年美国私人证券诉讼改革法案”（1995 年私人证券诉讼改革法案）中“安全港”（安全港）条款的规定。这些前瞻性声明基于目前数据及预期，并且受到诸多风险与不确定性影响。由于各种实际因素，例如（由于成本，性能抑或其他原因造成的）新技术推迟、其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA 产品的实施、性能或使用的意外技术挑战或限制等影响，实际结果可能与此类声明中的预计结果大不相同。

投资者关系：Ed Lockwood，投资者关系高级总监，（408）875-9529，ed.lockwood@kla.com；

媒体关系：Becky Howland 博士，企业传播高级主管，（408）875-9350，becky.howland@kla.com